

文獻

(19) 日本国特許庁 (J P)

(12) 公開特許公報 (A)

(11)特許出願公開番号

特開平10-92722

(43)公開日 平成10年(1998)4月10日

(51)Int.Cl.*	識別記号	F I	
H 0 1 L 21/027		H 0 1 L 21/30	5 1 6 D
G 0 3 F 7/20	5 2 1	G 0 3 F 7/20	5 2 1
		H 0 1 L 21/30	5 1 4 E

審査請求 未請求 請求項の数6 O.L (全 20 頁)

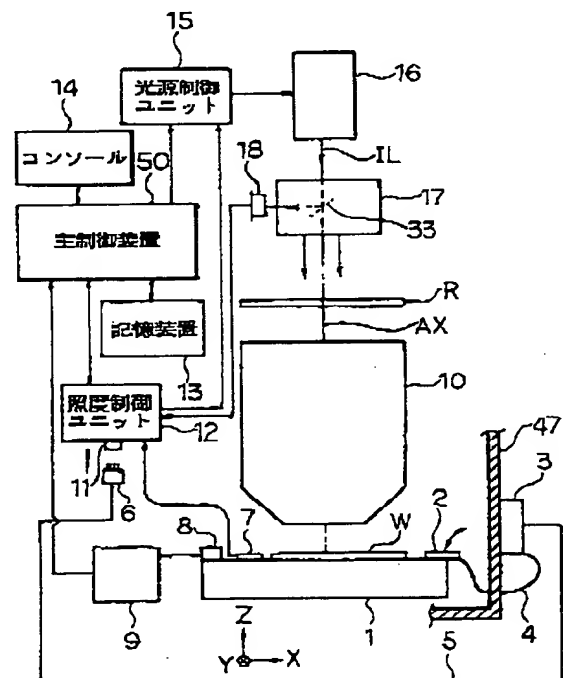
(21)出願番号	特願平8-245809	(71)出願人	000004112 株式会社ニコン 東京都千代田区丸の内3丁目2番3号
(22)出願日	平成8年(1996)9月18日	(72)発明者	西 健爾 東京都千代田区丸の内3丁目2番3号 株 式会社ニコン内
		(74)代理人	弁理士 大森 聡

(54) 【発明の名称】 露光装置

(57) 【要約】

【課題】 露光装置に備えられた照度センサの較正精度を高め、較正用のデータの処理速度を高める。

【解手段】 照明系 17 中のビームスプリッタ 33 により分割された露光光 I L の照度を検出するインテグレートセンサ 18、及びウエハステージ 1 上に固定された固定型照度センサ 7 等の常設の照度センサを較正するための着脱型照度計 2 をウエハステージ 1 上に着脱自在に設置し、着脱型照度計 2 からの出力信号をセンサ制御装置 3 等を介して照度制御ユニット 12 にオンラインで供給する。例えばインテグレートセンサ 18 の較正に際し、露光光 I L の照度をインテグレートセンサ 18 及び着脱型照度計 2 で同期して計測し、それらの出力信号を照度制御ユニット 12 内で演算処理する。



特開平10-92722

【特許請求の範囲】

【請求項1】 感光基板の位置決めを行う基板ステージを有し、露光用の照明光のもとでマスクに形成されたパターンを前記基板ステージ上の前記感光基板に転写露光する露光装置において、

前記基板ステージ上に着脱自在で該基板ステージ上での前記照明光の照度を直接計測する着脱型の照度センサと、

前記基板ステージ上での前記照明光の照度を直接的、又は間接的に計測する常設の照度センサと、

前記着脱型の照度センサの計測データを取り込むインタフェース装置と、

該インタフェース装置を介して取り込まれる前記着脱型の照度センサの計測データと前記常設の照度センサの計測データとの関係を求めて記憶する露光量制御手段と、を有することを特徴とする露光装置。

【請求項2】 請求項1記載の露光装置であって、前記常設の照度センサは、前記照明光から分離された光束の照度を検出することによって前記基板ステージ上での前記照明光の照度を間接的に計測する間接型の照度センサであり、

前記露光量制御手段は、前記インタフェース装置を介して前記着脱型の照度センサの計測データを取り込むのに同期して前記常設の照度センサの計測データを取り込むことを特徴とする露光装置。

【請求項3】 請求項1、又は2記載の露光装置であって、

前記露光用の照明光はパルス発光される照明光であり、前記露光量制御手段は、前記露光用の照明光のパルス発光に同期して前記インタフェース装置を介して前記着脱型の照度センサの計測データを取り込むことを特徴とする露光装置。

【請求項4】 請求項1、2、又は3記載の露光装置であって、

前記インタフェース装置は、コードレス方式で前記着脱型の照度センサの計測データを前記露光量制御手段に供給することを特徴とする露光装置。

【請求項5】 感光基板の位置決めを行う基板ステージを有し、露光用の照明光のもとでマスクに形成されたパターンを前記基板ステージ上の感光基板に転写露光する露光装置において、

前記基板ステージ上での前記照明光の照度を直接的、又は間接的に計測する常設の照度センサと、

前記基板ステージ上に着脱自在で、前記常設の照度センサの出力の較正を行うために前記基板ステージ上での前記照明光の照度を直接計測する第1の着脱型の照度センサと、

所定の基準となる第2の着脱型の照度センサの出力に対する前記第1の着脱型の照度センサの出力の補正値を記憶する記憶手段と、を有することを特徴とする露光装置。

置。

【請求項6】 感光基板の位置決めを行う基板ステージを有し、露光用の照明光のもとでマスクに形成されたパターンを前記基板ステージ上の感光基板に転写露光する露光装置において、

前記基板ステージ上での前記照明光の照度を直接的、又は間接的に計測する常設の照度センサと、

前記基板ステージ上に着脱自在で、前記常設の照度センサの出力の較正を行うために前記基板ステージ上での前記照明光の照度を直接計測する第1の着脱型の照度センサと、

該第1の着脱型の照度センサの出力の基準となる第2の着脱型の照度センサと、

前記基板ステージ上での前記露光用の照明光を分割して前記第1及び第2の着脱型の照度センサに導く分割光学系と、

前記第1及び第2の着脱型の照度センサの出力を並行に取り込んで比較する信号処理装置と、を有することを特徴とする露光装置。

【発明の詳細な説明】

【0001】

【発明の属する技術分野】本発明は、例えば半導体素子、液晶表示素子、撮像素子（CCD等）、又は薄膜磁気ヘッド等を製造するためのフォトリソグラフィ工程でマスク上のパターンを感光基板上に露光するために使用される露光装置に関し、更に詳しくは感光基板が載置されるステージ上での露光光の照度を直接的、又は間接的に計測するための常設の照度センサの較正を行う機能を備えた露光装置に関する。

【0002】

【従来の技術】従来より、例えば半導体素子等を製造するために、マスクとしてのレチクル（又はフォトマスク等）のパターンを投影光学系を介して、感光基板としてのフォトリソグが塗布されたウエハ（又はガラスプレート等）上に転写するための一括露光型の投影露光装置（ステッパー等）、又は投影光学系を介さずに直接ウエハ上にレチクルのパターンを転写するプロキシミティ方式の露光装置等の露光装置が使用されている。また、最近では投影光学系を大型化することなく、実質的に露光面積を大きくするために、レチクルとウエハとを投影光学系に対して同期走査してレチクルのパターンをウエハ上の各ショット領域に逐次転写するステップ・アンド・スキャン方式等の走査露光型の投影露光装置も使用されつつある。

【0003】一般にウエハ上のフォトリソグには適正露光量が定められている。そこで、そのような露光装置には、ウエハ上での露光光の照度を直接的、又は間接的に計測するための照度センサが備えられ、この照度センサの計測値に基づいてウエハ上での露光量を制御している。図12は、従来の照度センサを備えた投影露光装置

特開平10-92722

を示し、この図12において、露光光源109から射出された露光光ILは、照明系103を介してレチクルRのパターン領域を照明し、その露光光ILのもとでレチクルRのパターンの像が投影光学系102を介して、フォトレジストが塗布されたウエハW上の各ショット領域に転写される。ウエハWはこのウエハを3次元的に位置決めするためのウエハステージ101上に保持されている。

【0004】また、照明系103は、フライアイレンズ、このフライアイレンズから射出された露光光の一部を分離するビームスプリッタ111、及びコンデンサレンズ等を備え、そのビームスプリッタ111で分離された露光光ILが、光電検出器よりなる照度センサとしてのインテグレートセンサ110に入射し、インテグレートセンサ110の出力信号が照度制御ユニット105に供給されている。この照度制御ユニット105は装置全体の動作を制御する主制御装置107に接続され、主制御装置107が入力装置やディスプレイよりなるコンソール112に接続されている。

【0005】ビームスプリッタ111は一定の反射率を有し、インテグレートセンサ110で検出された照度に基づいて、ビームスプリッタ111を透過してウエハWへ向かう光量の算出が可能である。しかし、実際にはレチクルRや投影光学系102等における反射及び吸収による光量を勘案する必要がある。そのため、後述のように予めウエハステージ101上に設置した照度計の出力値に対するインテグレートセンサ110の出力値の比の値が求められて主制御装置107に記憶され、露光時に主制御装置107ではその比の値、及びインテグレートセンサ110の出力値よりウエハW上での露光光の照度を求め、この照度に基づいてウエハWに対する露光量を制御する。

【0006】また、ウエハステージ101上のウエハWの近傍に、この装置専用の常設の光電検出器よりなる照度センサ104が固定され、この照度センサ104の出力信号が信号ケーブル106を介して照度制御ユニット105に供給されている。そして、例えば露光に先立ち、照度センサ104の受光部を投影光学系102の露光フィールド内に設定し、必要に応じて移動することによって露光光のウエハステージ101上での照度や照度むら等が計測される。

【0007】この場合、半導体素子等の製造ラインには多数の露光装置が設置されているため、各露光装置でウエハに与える露光量間のマッチングを取る必要があり、そのためには露光装置に備えられているインテグレートセンサ110及び照度センサ104等の入射光量に対する出力（感度）の校正を行う必要がある。即ち、フォトレジストに対する適正露光量は、ある照度のもとで実際に露光時間を種々変えて露光したウエハを現像し、これによって現れた像の内で例えば最も解像度が高い像の

露光時間と、その照度とから決定される。このため、露光装置毎に照度センサの感度が異なっていると、その感度の違いにより露光装置毎に適正露光量がそれぞれ異なってくる。それらのインテグレートセンサ110及び照度センサ104の感度の校正を行うために、従来より基準となる着脱自在の照度計108が使用されている。

【0008】即ち、照度計108は他の露光装置とのマッチングを取るために、ウエハステージ101より着脱自在、且つウエハステージ101上で移動可能に構成されており、照度計108の出力信号は、表示部113へ信号ケーブル114を介して供給され、表示部113に照度計108の計測値が表示される。この場合、表示部113はオペレータが表示内容を見易いように図12の投影露光装置が収納されているチャンバの外部に設置されている。このように、照度計108がウエハステージ101に対して着脱自在であるため、照度計108を用いて、以下のようにインテグレートセンサ110及び照度センサ104の感度の校正が行われる。その結果、任意の露光装置でウエハ上のフォトレジストに対して所定の露光量（ドーズ）を与える場合、同じ露光量を他の露光装置でも与えることができるようになる。

【0009】図12の投影露光装置において、インテグレートセンサ110及び照度センサ104の感度校正を行う場合には、ウエハステージ101上の所定位置に照度計108を取り付け、照度計108を投影光学系102の露光フィールドの中心付近に移動した後、主制御装置107からの指令に基づいて、露光光源109を点灯し、ウエハステージ101上での照度を照度計108で計測する。この照度計108の出力値IAは表示部113で表示されて、オペレータによって記録される。

【0010】次に、ウエハステージ101上に固定された常設の照度センサ104を投影光学系102の露光フィールドの中心付近に移動し、照度を計測する。照度センサ104の出力値IBは照度制御ユニット105においてアナログ/デジタル(A/D)変換され、このA/D変換後の計測データが主制御装置107に供給される。これと並列に、常設のインテグレートセンサ110の出力値ICも照度制御ユニット105でサンプリングされて、主制御装置107に供給される。主制御装置107に供給された照度センサ104の出力値IB及びインテグレートセンサ110の出力値ICは主制御装置107からコンソール112に送られ、コンソール112のディスプレイに出力値IB、ICが表示される。

【0011】ここで露光光源109の出力を一定と仮定し、オペレータは照度計108の出力値IAに対する、インテグレートセンサ110の出力値ICの比の値 k_{AC} ($=IA/IC$)を求める。この比の値 k_{AC} がインテグレートセンサ110の校正のためのパラメータとなる。即ち、露光時のインテグレートセンサ110の出力値にパラメータ k_{AC} を乗じることで、他の露光装置との対応

特開平10-92722

が取られたウエハW上の実際の照度が計算できる。また、照度計108の出力値IAに対する照度センサ104の出力値IBの比の値 k_{AB} は、照度センサ104の校正のためのパラメータとなる。即ち、照度センサ104の出力値にパラメータ k_{AB} を乗じることで他の露光装置との対応が取られた照度が算出される。

【0012】

【発明が解決しようとする課題】上記の如き従来の技術においては、基準となる照度計108の出力値を表示部113から読み取るタイミングと、照度センサ104及びインテグレートセンサ110の出力値をコンソール112を介して計測するタイミングとが異なるため、露光光源109の出力に時間的なばらつきがあると、上述のように計測されるパラメータ k_{AC} 、 k_{AB} が変動する。そこで、従来はこの変動の影響を軽減するために、照度計108等の出力値IA、IB、ICを長時間計測して平均化するか、又はそれらの出力値IA、IB、ICを複数回計測したときのピークホールド値をそれぞれ求めることで、パラメータ k_{AC} 、 k_{AB} を算出していた。しかしながら、何れの方法でも出力値IAの計測のタイミングと、出力値IB、ICの計測のタイミングとの間のずれは小さくならないために、得られるパラメータの計測精度をあまり高められないという不都合があった。

【0013】更に、基準となる照度計108の出力値IAの表示部113と、照度センサ104及びインテグレートセンサ110の出力値を表示するコンソール112とが離れて独立に管理されているため、計測結果を同時に処理できず、パラメータ k_{AC} 、 k_{AB} の算出に時間がかかるという不都合もあった。また、多数の露光装置を並列に使用するような場合には、基準となる照度計108を複数個用意して、並列に各露光装置の常設の照度センサの校正を行う場合もある。このような場合に、各照度計108間の出力のマッチング精度が悪いと、各露光装置間での照度のマッチング精度も低下するという不都合があった。

【0014】本発明は斯かる点に鑑み、備えられている照度センサの校正を高精度に行うことができると共に、その校正のための計測データを高速処理できる露光装置を提供することを第1の目的とする。更に本発明は、基準となる照度センサの校正を高精度に行うことによって、露光装置間での照度の計測値のマッチング精度を高めることができる露光装置を提供することを第2の目的とする。

【0015】

【課題を解決するための手段】本発明による第1の露光装置は、例えば図1に示すように、感光基板(W)の位置決めを行う基板ステージ(1)を有し、露光用の照明光(IL)のもとでマスク(R)に形成されたパターンを基板ステージ(1)上の感光基板(W)に転写露光する露光装置において、基板ステージ(1)上に着脱自在

で基板ステージ(1)上での照明光(IL)の照度を直接計測する着脱型の照度センサ(2)と、基板ステージ(1)上での照明光(IL)の照度を直接的、又は間接的に計測する常設の照度センサ(7, 18)と、着脱型の照度センサ(2)の計測データを取り込むインタフェース装置(3~6, 11)と、このインタフェース装置を介して取り込まれる着脱型の照度センサ(2)の計測データと常設の照度センサ(7, 18)の計測データとの関係を求めて記憶する露光量制御手段(12, 50)と、を有するものである。

【0016】斯かる本発明の第1の露光装置によれば、着脱自在の照度センサ(2)からインタフェース装置(3~6, 11)を介して直接計測データが取り込まれ、ほぼ同時に常設の照度センサ(7, 18)の計測データも取り込まれ、着脱型の照度センサ(2)の計測データと常設の照度センサ(7, 18)の計測データとの関係、即ち計測データの比の値、又はオフセット等が求められる。これは常設の照度センサ(7, 18)の計測データの校正が行われたことを意味する。この際に、着脱自在の照度センサ(2)、及び常設の照度センサ(7, 18)の計測データはほぼ同時に取り込まれているため、露光用の照明光(IL)の光源の出力の時間変動、例えば水銀ランプのアーク揺らぎによる出力の変動や、エキシマレーザ光源のパルスエネルギーのばらつきがあっても、2つの照度センサの計測データの関係が正確に求められ、常設の照度センサ(7, 18)の校正が高精度に行われる。

【0017】また、2つの照度センサの計測データは共通に露光量制御手段(12, 50)に取り込まれてオンラインで高速処理されるため、常設の照度センサ(7, 18)の校正が高速に行われる。また、オペレータの介入等に起因する入力の間違い等が発生しない。この場合、その常設の照度センサの一例は、照明光(IL)から分離された光束の照度を検出することによって基板ステージ(1)上での照明光(IL)の照度を間接的に計測する間接型の照度センサ(18)であり、その場合、露光量制御手段(12, 50)は、インタフェース装置(3~6, 11)を介して着脱型の照度センサ(2)の計測データを取り込むのに同期して常設の照度センサ(18)の計測データを取り込むことが望ましい。ここで、間接型の照度センサ(18)とは、照明光(IL)から分割された光束の照度を検出するインテグレートセンサを意味し、インテグレートセンサ及び着脱型の照度センサ(2)の計測データを同期して取り込むことによって、露光用光源の出力の時間変動の影響が無くなり、インテグレートセンサの校正が高精度に行われる。

【0018】また、露光用の照明光(IL)が、パルス発光される照明光である場合、露光量制御手段(12, 50)は、露光用の照明光(IL)のパルス発光に同期してインタフェース装置(3~6, 11)を介して着脱

特開平10-92722

型の照度センサ(2)の計測データを取り込むことが望ましい。これにより2つの照度センサの計測タイミングがずれることなく、パルスエネルギーのばらつきがあっても、着脱型の照度センサ(2)に対して常設の照度センサ(7, 18)の較正が高精度に行われる。

【0019】また、例えば図1及び図2(c)に示すように、インタフェース装置(3, 5, 6, 11)は、コードレス方式で着脱型の照度センサ(2A)の計測データを露光量制御手段(12, 50)に供給するようにしてもよい。通常露光装置は温度制御等が行われたチャンバ内に収納されるが、コードレス方式であれば、チャンバの壁を通る配線が不要になるため、着脱型の照度センサ(2A)の取扱いが容易になる。

【0020】また、本発明による第2の露光装置は、例えば図1、図2及び図10に示すように、感光基板(W)の位置決めを行う基板ステージ(1)を有し、露光用の照明光(IL)のもとでマスク(R)に形成されたパターンを基板ステージ(1)上の感光基板(W)に転写露光する露光装置において、基板ステージ(1)上での照明光(IL)の照度を直接的、又は間接的に計測する常設の照度センサ(7, 18)と、基板ステージ(1)上に着脱自在で、常設の照度センサ(7, 18)の出力の較正を行うために基板ステージ(1)上での照明光(IL)の照度を直接計測する第1の着脱型の照度センサ(2)と、所定の基準となる第2の着脱型の照度センサ(A1)の出力に対する第1の着脱型の照度センサ(2)の出力の補正值(比の値等も含む)を記憶する記憶手段(25)と、を有するものである。

【0021】斯かる本発明の第2の露光装置によれば、第2の着脱型の照度センサ(A1)は第1の照度センサ(2)に対する親機となり、絶対照度の管理が親機、子機、孫機のように段階的に管理される。例えば多数の露光装置を並列に使用するような場合には、基準となる着脱型の照度センサ(2)が多数必要になる。この際に、親機(A1)の入射光量に対する出力の直線性を絶対照度基準とした場合、子機(2)の出力を親機の出力に対する補正值で補正することによって、多数の露光装置間での照度の計測値のマッチング精度が向上する。

【0022】また、本発明による第3の露光装置は、例えば図1及び図11に示すように、感光基板(W)の位置決めを行う基板ステージ(1)を有し、露光用の照明光(IL)のもとでマスク(R)に形成されたパターンを基板ステージ(1)上の感光基板(W)に転写露光する露光装置において、基板ステージ(1)上での照明光(IL)の照度を直接的、又は間接的に計測する常設の照度センサ(7, 18)と、基板ステージ(1)上に着脱自在で、常設の照度センサ(7, 18)の出力の較正を行うために基板ステージ(1)上での照明光(IL)の照度を直接計測する第1の着脱型の照度センサ(2)と、この第1の着脱型の照度センサの出力の基準となる

第2の着脱型の照度センサ(A1)と、基板ステージ(1)上での露光用の照明光(IL)を分割して第1及び第2の着脱型の照度センサ(2, A1)に導く分割光学系(61, 62, 63A, 63B)と、第1及び第2の着脱型の照度センサ(2, A1)の出力を並行に取り込んで比較する信号処理装置(59)と、を有するものである。

【0023】斯かる本発明の第3の露光装置によれば、基板ステージ(1)上においてその分割光学系により分割された照明光(IL)の照度を第1及び第2の着脱型の照度センサ(2, A1)により計測して、第1の着脱型の照度センサ(2)の較正を行うことができるため、照明光(IL)の揺らぎや途中の光学系等による影響がなく、第1の着脱型の照度センサ(2)が高精度に較正される。即ち、親機として照度センサ(A1)に対して子機としての照度センサ(2)の較正が行われる。そして、その高精度に較正された第1の着脱型の照度センサ(2)により、常設の照度センサ(7, 18)が高精度で較正される。これによって、露光装置間での照度のマッチング精度が向上する。

【0024】

【発明の実施の形態】以下、本発明による露光装置の第1の実施の形態につき図1～図7を参照して説明する。本発明はステッパ型、又はステップ・アンド・スキャン方式等の何れの露光装置にも適用できるが、以下の実施の形態は、ステッパ型の投影露光装置に本発明を適用したものである。

【0025】図1は、本例の投影露光装置の概略構成を示し、この図1において、露光時には水銀ランプよりなる露光光源及びシャッタ等を含む光源部16から、ウエハ上のフォトリソに感光性の露光光ILが射出される。光源部16内のシャッタの開閉は、装置全体の動作を統轄制御する主制御装置50が光源制御ユニット15を介して制御し、光源部16内の露光光源の出力も光源制御ユニット15によって制御されており、その露光光源の出力、及びシャッタの開閉により1ショットの露光量が制御される。露光光ILとしては、水銀ランプのi線(波長365nm)やg線等の輝線が使用できる。露光光源としては、その他に、ArFエキシマレーザ光源やKrFエキシマレーザ光源、あるいは銅蒸気レーザ光源やYAGレーザの高調波発生装置等も使用できる。

【0026】光源部16から射出された露光光ILは、照明系17に入射する。図4は、照明系17の内部構成を示す構成図であり、この図4に示すように、照明系17に入射した露光光ILは、オブティカル・インテグレートとしてのフライアイレンズ31に入射する。フライアイレンズ31の各レンズエレメントの射出面にはそれぞれ2次光源が形成され、これらの2次光源により面光源が作られる。フライアイレンズ31の射出面、即ち照明系17の瞳面に面光源の大きさや形状を調整するため

特開平10-92722

の切り換え自在の複数の開口絞りが配置されている。これらの開口絞りはターレット状の円板30に固定され、円板30を主制御装置50により駆動装置50Aを介して回転することで所望の開口絞りをフライアイレンズ31の射出面に設定できる。

【0027】図6(a)は、図4の円板30上の開口絞りの配置を示し、この図6(a)において、6個の開口絞り52A~52Fが円板30の中心の周りに等角度間隔で固定されている。第1の開口絞り52Aは中間のコヒーレンスファクタ(σ 値)で照明を行う場合に使用される円形開口を有し、第2の開口絞り52B及び第3の開口絞り52Cは、それぞれ中心部を遮光した輪帯開口、及び通常の輪帯照明用の開口である。また、第4の開口絞り52Dは通常の照明を行う場合に使用される円形開口であり、第5の開口絞り52Eは周辺に4個の小円形の開口部を有する、所謂変形照明用の開口絞りである。第6の開口絞り52Fは小さい σ 値で照明を行う場合に使用される小さい円形開口を有する。

【0028】図4に戻り、ここではフライアイレンズ31の射出面に第1の開口絞り52Aが配置されている。第1の開口絞り52Aを通過した露光光ILはビームスプリッタ33に入射する。ビームスプリッタ33は入射する光束の殆どを透過させ、残りを反射する。露光光IL中の一定の割合の光束が、ビームスプリッタ33から露光光ILの入射光路に対してほぼ直交する方向に反射され、この反射された光束が集光レンズ43を介してフォトダイオード等からなるインテグレートセンサ18に入射する。

【0029】一方、ビームスプリッタ33を透過した露光光ILは、第1リレーレンズ29を介して可変視野絞り(レチクルブラインド)28の開口上に集光され、可変視野絞り28により露光光ILのレチクル上での照明範囲が規定される。可変視野絞り28の開口の形状及び大きさは、駆動装置50Bを介して主制御装置50により設定される。可変視野絞り28を通過した露光光ILは、第2リレーレンズ27、及びコンデンサレンズ26を介してレチクルRのパターン領域に照射される。

【0030】図1に戻り、露光光ILのもとで、レチクルRのパターンの像が投影光学系10を介して投影倍率 β (β は例えば $1/4$ 、 $1/5$ 等)で、ウエハW上の各ショット領域のフォトレジスト層に転写される。以下、投影光学系10の光軸AXに平行にZ軸を取り、Z軸に垂直な平面内で図1の紙面に平行にX軸、図1の紙面に垂直にY軸を取って説明する。この場合、照明系17からの光束を受光したインテグレートセンサ18からの光電信号は、照度制御ユニット12に供給され、照度制御ユニット12においてアナログ/デジタル(A/D)変換される。照度制御ユニット12からは、A/D変換されたデジタルデータに基づいて、主制御装置50及び光源制御ユニット15に直接現在の露光光ILの照度の情

報が送られ、光源制御ユニット15では、送られた照度が予め設定された照度になるように光源部16内の露光光源の出力を制御する。また、主制御装置50では、予めインテグレートセンサ18の出力とウエハW上での露光光の照度との関係が記憶されており、この関係よりウエハW上での照度を算出し、この算出された照度の積算値がウエハW上のフォトレジストに対する適正積算露光量になるように、光源制御ユニット15を介して光源部16内のシャッタの開閉動作を制御する。

【0031】なお、露光光源がエキシマレーザ光源のようなパルス光源で、且つステッパーのような一括露光型の場合には、光源部16内のシャッタの開閉、光源部16内に設けた減光機構の制御、又はレーザ光源自体の光量可変システム(可変電源等)の制御等によって積算露光量の制御が行われる。一方、露光光源がパルス光源で、且つステップ・アンド・スキャン方式のような走査露光型の場合には、光源部16内に設けられる減光機構により露光光の照度を制御するか、又は露光光の照明領域の走査方向の幅や走査速度を制御する等により、積算露光量を制御できる。

【0032】図1において、レチクルRはX方向、Y方向、及び回転方向に微動可能なレチクルステージ(不図示)上に載置されている。レチクルステージの位置は外部に設けた不図示のレーザ干渉計によって高精度に計測されており、そのレーザ干渉計の測定値に基づいて主制御装置50はレチクルステージの位置決めを行う。一方、ウエハWは不図示のウエハホルダ上に真空吸着により保持され、ウエハホルダはX方向、Y方向に移動自在なウエハステージ1上に固定されている。ウエハステージ1には、ウエハWのZ方向の位置や傾斜角等を制御するステージ系も組み込まれている。ウエハステージ1のX方向、Y方向の位置はウエハステージ1上の移動鏡8及び外部のレーザ干渉計9により高精度に計測されており、レーザ干渉計9の計測値は主制御装置50に供給されている。主制御装置50はその計測値に基づいて、ウエハステージ1の位置決め動作を制御する。ウエハステージ1によりウエハWの各ショット領域の中心を投影光学系10の露光中心に移動する動作と、露光動作とがステップ・アンド・リピート方式で繰り返されて、レチクルRのパターンがウエハWの各ショット領域に順次転写される。更に、主制御装置50には、入力装置とディスプレイとを有するコンソール14、及び各種パラメータ等を記憶するための記憶装置13も接続されている。

【0033】また、ウエハステージ1上のウエハWの近くにはフォトダイオード等からなる常設の固定型照度センサ7が設けられている。本例の固定型照度センサ7は、ウエハステージ1上での露光光ILの照度むら計測用のセンサ、最大照度計測用のセンサ、及び露光光ILの全部の照射量を計測するための照射量モニタとして使用される。固定型照度センサ7の受光面はウエハWの表

特開平10-92722

面とほぼ同じ高さに設定されており、固定型照度センサ7により投影光学系10の露光フィールド内の照度又は照射量を計測する際は、ウエハステージ1を駆動して固定型照度センサ7の受光部を所望の計測点に移動する。固定型照度センサ7の出力信号は照度制御ユニット12に供給されてA/D変換される。

【0034】このように本例では、常設の照度センサとしてインテグレータセンサ18、及び固定型照度センサ7が備えられている。そのため、多数の投影露光装置を使用して露光を行うような場合に、各投影露光装置で互いに等しい露光量を設定できるように、インテグレータセンサ18、及び固定型照度センサ7の較正（キャリブレーション）を行う必要がある。

【0035】その較正を行うためにウエハステージ1上には、照度の基準となる着脱型照度計2が取り外しできるように設置されている。即ち、常設の照度センサの較正を行う際には、オペレータが着脱型照度計2をウエハステージ1上に取り付ける。この際に、着脱型照度計2の受光面もウエハWの表面とほぼ同じ高さになるように設定されると共に、ウエハステージ1を駆動することで着脱型照度計2の受光部をX方向、Y方向に移動できるようになっている。また、着脱型照度計2は、関係する露光装置間の照度のマッチングを取るために、それらの露光装置間で共通に使用される。

【0036】この場合、本例の投影露光装置の機構部は空調されたチャンバ47の内部に設置され、照度制御ユニット12、主制御装置50及びコンソール14等の制御部はチャンバ47の外部に設置されている。そして、チャンバ47の外面に、センサ制御装置3がマグネットチャックにより固定されている。着脱型照度計2とセンサ制御装置3とは、チャンバ47の側壁を貫通する信号ケーブル4を介して接続されている。

【0037】図2(a)は、着脱型照度計2の詳細な構成を示す拡大図、図2(b)は図2(a)の平面図を示している。図2(a)及び(b)に示すように、着脱型照度計2は光電変換部25、及びこの底部に被着された温調素子20より構成され、光電変換部25上の円形の受光部19に入射する光量が光電変換され、光電変換部25の温度は温調素子20によって所定の許容温度以上にならないように冷却されている。即ち、温調素子20はペルチェ素子等の冷却素子等からなり、温調素子20の光電変換部25に接する面が冷却面となっている。温調素子20により、露光光ILの照射エネルギーによる光電変換部25の温度上昇が抑えられ、感度等のセンサ特性のドリフトが軽減される。

【0038】光電変換部25及び温調素子20にはそれぞれ信号ケーブル4を介してセンサ制御装置3から電力が供給され、光電変換部25の出力信号が信号ケーブル4を介してセンサ制御装置3に供給されている。また、着脱型照度計2は押さえ金具21及び止めねじ22に

よりウエハステージ1上に固定され、押さえ金具21を取り外すだけで容易に着脱型照度計2をウエハステージ1から取り外せるようになっている。また、光電変換部25には、後述のようにこの着脱型照度計2より上位の基準となる照度センサの出力に対する較正用のデータを記憶した記憶部も含まれている。

【0039】図1に戻り、センサ制御装置3には着脱型照度計2から供給される出力信号、及び較正用のデータを送信するための信号ケーブル5の一端が接続され、その信号ケーブル5の他端にコネクタ6が取り付けられ、照度制御ユニット12にはコネクタ6に対応するコネクタ11が取り付けられている。そして、コネクタ6を照度制御ユニット12側のコネクタ11に差し込むことにより、着脱型照度計2と照度制御ユニット12とがセンサ制御装置3を介して接続され、着脱型照度計2の出力信号がセンサ制御装置3内でA/D変換された後、信号ケーブル5、コネクタ6、11、及び照度制御ユニット12内に組み込まれたGPIB規格、又はRS232C規格等の入出力制御部を介して、照度制御ユニット12内の信号処理部に取り込まれる。本例では、信号ケーブル4、5、センサ制御装置3、コネクタ6、11及び照度制御ユニット12内の入出力制御部が、着脱型照度計2と照度制御ユニット12内の信号処理部との間のインタフェース装置を構成している。

【0040】上述のように、インテグレータセンサ18及び固定型照度センサ7のそれぞれの出力信号も照度制御ユニット12に供給されており、常設の照度センサの較正時には主制御装置50の指令により、着脱型照度計2、固定型照度センサ7、及びインテグレータセンサ18の出力値に対して照度制御ユニット12において所定の演算が行われ、演算結果が主制御装置50に供給される。主制御装置50は、照度制御ユニット12により演算処理されたデータに基づいてインテグレータセンサ18及び固定型照度センサ7の較正用のパラメータを算出し、算出された結果は記憶装置13に記憶され、必要に応じてコンソール14に出力される。

【0041】なお、着脱型照度計2の出力を有線ではなく、図2(c)に示すように、無線（コードレス）で照度制御ユニット12に送信するようにしてもよい。図2(c)は、着脱型照度計から無線で出力信号を送信する例を示し、この図2(c)において、着脱型照度計2Aには光電変換部25、及び温調素子20Aの他に、独自の蓄電池及び無線送信機を有する電源部23が備えられている。そして、電源部23からの電力を用いて、光電変換部25、及び温調素子20Aを駆動し、更に無線送信機に接続されたアンテナ24から例えばFM電波を介して光電変換部25の出力信号を、無線受信器及びアンテナを備えたセンサ制御装置3に供給する構成となっている。

【0042】この場合、温調素子20Aの底部には、ウ

特開平10-92722

エハステージ1上に容易に設置できるようにマグネットチャックが取り付けられており、ウエハステージ1に設けた凸状の押さえガイド46に温調装束子20Aの側面を押し当てることで、着脱型照度計2Aの粗い位置決めができるように構成されている。このように着脱型照度計2Aとセンサ制御装置3、ひいては図1の照度制御ユニット12とをコードレスで接続することによって、チャンバ47内のウエハステージ1に対する着脱型照度計2Aの着脱を容易に行うことができる。

【0043】図1に戻り、不図示であるが、投影光学系10の両側にはウエハWのZ方向の位置（焦点位置）を検出するための、送光系及び受光系からなる斜入射方式の焦点位置検出系が備えられている。この焦点位置検出系からのウエハWの焦点位置に関する情報は主制御装置50に供給され、主制御装置50はその情報に基づいてウエハステージ1を駆動することで、ウエハWの焦点位置及び傾斜角を制御して、ウエハWの表面を投影光学系10の像面に合わせ込んで露光を行う。

【0044】次に、本例の着脱型照度計2、インテグレートセンサ18及び固定型照度センサ7で照度を計測する場合の基本的な動作につき説明する。インテグレートセンサ18及び固定型照度センサ7の出力を較正する際には、着脱型照度計2が使用されるが、そのためには先ず着脱型照度計2の位置を正確に求める必要がある。着脱型照度計2の位置の計測は以下のように行われる。

【0045】図3(a)は、ウエハステージ1上での投影光学系10による露光フィールドEFを示す正面図、図3(b)はその露光フィールドEFを示す拡大平面図であり、図3(a)及び(b)に示すように、露光光ILが投影光学系10のほぼ正方形の露光フィールドEFに照射されている。この露光光ILが照射された状態で、図1の主制御装置50はレーザ干渉計9の位置情報に基づいて、ウエハステージ1を駆動し、図3(b)に示すように、着脱型照度計2の受光部19を露光フィールドEFに対しX方向及びY方向に走査する。そして、そのときに着脱型照度計2の受光部19に入射した光量を、照度制御ユニット12を介して複数の所定の位置でサンプリングする。

【0046】図3(c)は、受光部19をX方向に走査する場合のウエハステージ1のX座標とサンプリングされた着脱型照度計2の出力信号Iとの関係を示し、横軸はウエハステージ1のX座標、縦軸は出力信号Iを表す。この図3(c)に示すように、出力信号Iは受光部19が露光フィールドEF内にある範囲で大きく、それ以外では小さい。そこで、例えば出力信号Iの最大値と最小値との間の所定のスライスレベルIAとその出力信号Iとを比較し、出力信号IがスライスレベルIAを横切るときのウエハステージ1のX座標X1及びX2を求め、更に座標X1及びX2の中点の座標XSを求める。この座標XSは着脱型照度計2の受光部19の中心が投

影光学系10の露光フィールドEFの中心（露光中心）にあるときのウエハステージ1の座標を示す。

【0047】従って、これによりウエハステージ1上に設置された着脱型照度計2の投影光学系10の露光フィールドEFに対するX方向の相対位置が求められる。なお、着脱型照度計2による照度測定に際しては、上述の斜入射方式の焦点位置検出系により、投影光学系10の像面と着脱型照度計2の受光部19の表面とが一致するようにオートフォーカス制御が行われている。なお、その焦点位置検出系を使用する代わりに、X方向の相対位置を求めるための図3(c)の出力信号を着脱型照度計2の受光部19の焦点位置を変えて複数回計測し、両側のスロープ部の傾きを算出してよい。このとき、最もスロープの傾きが高くなる焦点位置を求めることで着脱型照度計2の受光部19と投影光学系10の像面とを一致させることができる。同様に、受光部19を露光フィールドEFに対してY方向に走査することによって、着脱型照度計2の露光フィールドEFに対するY方向の相対位置が求められる。また、固定型照度センサ7についても、同様にして露光フィールドEFに対する相対位置が求められる。

【0048】次に、着脱型照度計2、インテグレートセンサ18及び固定型照度センサ7による照度の計測方法について説明する。図4は、図1の照明系17及び照度センサを示す構成図であり、この図4に示すように、本例では照明系17内で分離された露光光ILの一部がインテグレートセンサ18で受光されている。この際に、インテグレートセンサ18の受光面は、レチクルRのパターン面、ひいては図1のウエハWの表面とほぼ共役となっている。

【0049】この場合、光学部材の配置空間の制約、及び製造コスト等から、インテグレートセンサ18への送光部である集光レンズ43等は小型化されているため、インテグレートセンサ18の受光部をウエハステージ1上に投影した共役像18Aは、図5(a)に示すように、投影光学系10の露光フィールドEFに比較して小さな面積で形成されている。従って、インテグレートセンサ18では、その露光フィールドEF内でその共役像18Aの範囲での照度を間接的に計測できることになる。また、その共役像18Aの中心は、その露光フィールドEFの中心（露光中心）に設定されている。但し、製造コスト等に余裕があれば、共役像18Aを露光フィールドEFより大きくしてもよい。更に、インテグレートセンサ18の受光面は必ずしもウエハWの表面と共役である必要はなく、投影光学系10の瞳面（レチクルRに対する光学的フーリエ変換面）と共役であってもよい。

【0050】また、図5(a)に示すように、着脱型照度計2の受光部19はインテグレートセンサ18の受光部の共役像18Aよりも更に小さな面積で形成されてい

特開平10-92722

る。従って、着脱型照度計2を用いてインテグレートセンサ18の較正を精度よく行うためには、図4に示すように、ウエハステージ1を駆動して着脱型照度計2の受光部19を投影光学系10の露光フィールド内に移動した後、図5(a)の矢印で示すように、着脱型照度計2の受光部19をその共役像18Aの内部で移動して、所定の複数の計測位置で着脱型照度計2の出力をサンプリングする。そして、その出力の平均値を取ることで、インテグレートセンサ18の計測フィールド(共役像18Aの内部領域)での平均的な照度を算出する。この着脱型照度計2の計測と同期して、インテグレートセンサ18の出力のサンプリングも行っており、平均的な照度を算出する。このような計測方法を用いることにより、インテグレートセンサ18の計測フィールドと着脱型照度計2の計測範囲とが実質的に一致し、較正の信頼性が高まる利点がある。

【0051】このような計測方法は、固定型照度センサ7の計測時においても同様に行われる。即ち、図4において、固定型照度センサ7で照度を計測する際には、ウエハステージ1を駆動することによって、固定型照度センサ7の受光部7Aが投影光学系10の露光フィールド内に移動する。図5(b)は、固定型照度センサ7の受光部7Aが露光フィールドEF内に移動した状態を示し、この図5(b)に示すように、固定型照度センサ7の受光部7Aの面積は、図5(a)の着脱型照度計2の受光部19の面積より更に小さい。従って、インテグレートセンサ18の出力と固定型照度センサ7の出力との対応関係を求める場合には、図5(b)の矢印で示すように、固定型照度センサ7の受光部7Aをインテグレートセンサ18の計測フィールド(共役像18Aの内部領域)内で更にきめ細かく移動し、照度のサンプリングの回数を増やす。これによって、インテグレートセンサ18の計測フィールドと固定型照度センサ7の計測範囲とが実質的に一致する。なお、着脱型照度計2及び固定型照度センサ7の受光部の面積、形状を等しくすれば、同じ計測シーケンスでより精度良く照度計測ができることになる。

【0052】インテグレートセンサ18及び固定型照度センサ7の出力の較正は、ウエハステージ1上に照射される露光光ILの照度を段階的に変更して行われる。例えばインテグレートセンサ18の較正に際しては、先ず、照明系17からの露光光ILの光量を最大にしてウエハステージ1上の照度を計測する。即ち、図4において、フライアイレンズ31の射出面には図6(a)に示す最大の開口を有する第4の開口絞り52Dを配置し、可変視野絞り28の開口を最大にして、最大のコヒーレンスファクタ(σ 値)のもとでインテグレートセンサ18、及び着脱型照度計2の出力を同時に検出する。次に、 σ 値を段階的に変更して同様にインテグレートセンサ18、及び着脱型照度計2により照度を計測する。即

ち、近年のフォトリソグラフィ技術では、例えば、図6(a)の第6の開口絞り52Fを使用して小さな σ 値で照明する小 σ 照明や、第3の開口絞り52Cのような輪帯状の開口絞りを使用する輪帯照明等が利用される傾向にあり、このような照明条件の変化により較正結果が異なってくることがある。従って、照明条件を変えたときにも同様の較正を行う必要がある。

【0053】図6(b)及び(c)は、それぞれ小 σ 照明及び通常の照明条件時におけるレチクルR上での露光光の状態を示し、図6(b)及び(c)に示すように、小 σ 照明における露光光ILの開口半角 θ' は通常の照明条件における露光光ILの開口半角 θ に比較して小さい。一般に照度センサ自体の感度も光束の入射角によって変化するため、較正の基準となる着脱型照度計2の受光部19としては、感度変化の小さいものを採用し、インテグレートセンサ18としては、温度や露光光の照射によるセンサ特性のドリフトの少ないものを利用することで、較正精度を上げ、且つ較正を行う間隔を延ばすことができる。

【0054】次に、本例の投影露光装置において、着脱型照度計2を用いてインテグレートセンサ18、及び固定型照度センサ7の出力を較正する方法の一例について具体的に説明する。先ず、オペレータが図1のウエハステージ1上に着脱型照度計2を取り付け、チャンバ47の外面のセンサ制御装置3の信号ケーブル5を照度制御ユニット12に接続する。そして、主制御装置50に予めプログラムされた照度較正プログラムを作動させる。照度較正プログラムの起動に伴い、主制御装置50の制御のもとで、光源制御ユニット15を介して光源部16から露光光ILが射出され、図3に基づいて説明した方法により着脱型照度計2の受光部19の投影光学系10の露光フィールドEFに対する相対位置が計測される。

【0055】次に、この計測結果に基づいて、着脱型照度計2の受光部19の中心を投影光学系10の露光中心に位置決めする。本例のようなステッパ型の投影露光装置においては、一定の照度を持つ露光光ILを用いて、光源部16のシャッタの開閉を行ってウエハW上での露光時間を制御することで露光量を制御する。そこで、投影光学系10の露光中心に着脱型照度計2の受光部19の中心を位置決めした後、光源部16のシャッタを開放してインテグレートセンサ18に入る光量を連続してモニタし、その光量を積算した積算光量(積算露光量)QIが所定の値になるようにシャッタを閉じる。そして、シャッタを開放してから閉じるまでの照度をインテグレートセンサ18及び着脱型照度計2により計測する。インテグレートセンサ18の計測値は直接照度制御ユニット12に供給され、着脱型照度計2の照度の計測値はセンサ制御系3を介して照度制御ユニット12に供給される。照度制御ユニット12においては、インテグレートセンサ18の積算光量、及び着脱型照度計2にお

特開平10-92722

ける照度積算値 Q_S を求める。このとき求められたインテグレートセンサ18による積算光量 Q_I 、及び着脱型照度計2による照度積算値 Q_S をそれぞれ C_1 及び A_1 とする。そして、露光可能範囲の中で積算露光量を変えながらインテグレートセンサ18及び着脱型照度計2により同時に照度を検出し、それぞれの積算光量 C_i ($i = 2, 3, \dots, n$) 及び照度積算値 A_i を算出して主制御装置50に供給する。この照度検出の際に、図5を参照して説明したように、着脱型照度計2の受光部19をインテグレートセンサ18の受光部の共役像18A内で移動させてもよい。

【0056】図7(a)は、インテグレートセンサ18

$$P1 = (A_1/C_1 + A_2/C_2 + A_3/C_3 + \dots + A_n/C_n) / n \quad (1)$$

一方、固定型照度センサ7の較正用のパラメータは、較正後のインテグレートセンサ18を基準の照度センサとして求める。即ち、投影光学系10の露光中心に固定型照度センサ7の受光部の中心を移動し、上述の着脱型照度計2の場合と同様に、インテグレートセンサ18及び固定型照度センサ7に入射する光量を連続してモニタする。この際にも、固定型照度センサ7の受光部をインテグレートセンサ18の受光部の共役像内で移動させてもよい。ここで計測されたインテグレートセンサ18の積算光量 Q_I の値を C_i ($i = 1, 2, \dots, n$)、及び対応

$$P2 = (B_1/C_1 + B_2/C_2 + B_3/C_3 + \dots + B_n/C_n) / n \quad (2)$$

このように露光光の照度が一定であるステップ型の投影露光装置の場合は、較正パラメータ $P1$ 、 $P2$ が容易に求められて記憶装置13に記憶される。そして、記憶されている較正パラメータ $P1$ 及び $P2$ をそれぞれインテグレートセンサ18及び固定型照度センサ7の実際の計測値に乗ずることで較正が行われる。即ち、インテグレートセンサ18の計測値に較正パラメータ $P1$ を乗ずることで、ウエハステージ1上で着脱型照度計2を用いて計測した場合に換算した照度が求められる。同様に、固定型照度センサ7の計測値に較正パラメータ $P2$ を乗ずることで、インテグレートセンサ18で計測した場合に換算した照度が求められる。更に、2つの較正パラメータ $P1$ 及び $P2$ の積 $P1 \cdot P2$ を新たに固定型照度センサ7の較正パラメータとしてもよい。この場合、固定型照度センサ7の計測値に較正パラメータ $P1 \cdot P2$ を乗ずることで、ウエハステージ1上で着脱型照度計2を用いて計測した場合に換算した照度が求められる。

【0059】また、上述のように較正パラメータ $P1$ を求める際に、本例では着脱型照度計2の出力信号はセンサ制御装置3、及び信号ライン5等を介して直接照度制御ユニット12に供給されており、インテグレートセンサ18の出力信号も直接照度制御ユニット12に供給されている。従って、水銀ランプのアーカ揺らぎ等によって光源部16からの露光光 IL の出力に時間変動があっても、インテグレートセンサ18及び着脱型照度計2の出力信号は同じタイミングで取り込むことができるた

における積算光量 Q_I と着脱型照度計2における照度積算値 Q_S との関係を示し、この図7(a)の実線の直線54で示すように、インテグレートセンサ18における積算光量 Q_S の実測値 C_1, C_2, \dots, C_n と、着脱型照度計2における照度積算値 Q_S の実測値 A_1, A_2, \dots, A_n との関係はほぼオフセットの無い線形となる。主制御装置50では、このときの着脱型照度計2の出力に対するインテグレートセンサ18の出力の比の値の平均値(以下、「インテグレートセンサ18の較正パラメータ」と呼ぶ) $P1$ を、次式より求める。

【0057】

して計測される固定型照度センサ7の照度積算値 Q_S の値を B_i とすれば、積算光量 C_i 及び照度積算値 B_i の間にも、図7(a)の点線の曲線54Aで示するようなほぼオフセットの無い線形の関係がある。主制御装置50では、このときのインテグレートセンサ18の出力に対する固定型照度センサ7の出力の比の値の平均値(以下、「固定型照度センサ7の較正パラメータ」と呼ぶ) $P2$ を、次式より求める。

【0058】

め、両者の出力の比の値、即ち較正パラメータ $P1$ を正確に求めることができ、インテグレートセンサ18の較正を高精度に行うことができる。また、較正パラメータ $P1 \cdot P2$ を使用する場合には、固定型照度センサ7を着脱型照度計2に対して高精度に較正することができる。更に、本例では着脱型照度計2、インテグレートセンサ18、及び固定型照度センサ7の計測値は共通に照度制御ユニット12で取り込まれているため、(1)式及び(2)式等の演算処理を高速に行うことができる。

【0080】次に、本例の投影露光装置はステップ型であるが、図1の投影露光装置がステップ・アンド・スキャン方式のような走査露光型であるとした場合に、着脱型照度計2を用いて、インテグレートセンサ18及び固定型照度センサ7の出力を較正する方法について説明する。走査露光型の投影露光装置においては、露光時には光源部16からの露光光 IL はレチクルR上のスリット状の照明領域に照射される。そして、レチクルR上のスリット状の照明領域内のパターンが投影光学系10を介してウエハW上に投影された状態で、レチクルRとウエハWとを投影光学系10に対して同期走査することにより、レチクルRのパターン像がウエハW上の露光対象のショット領域に逐次転写される。このように走査露光型では、連続的に露光が行われるため、インテグレートセンサ18の出力値の積算光量をモニタする代わりに、インテグレートセンサ18で計測される露光光の照度が常に所定の目標値に対して許容範囲内にあるかどうか

特開平10-92722

モニタされる。この場合、ウェハW上のフォトレジストの感度（適正露光量）をE、ウェハステージ1の走査速度をV、スリット状の照明領域をウェハW上に投影した露光領域の走査方向の幅（スリット幅）をL、ウェハW上での露光光ILの照度をSとすると、次の関係が成立する。

$$【0061】 E/S = L/V \quad (3)$$

露光工程のスループットを低下させないためには、できるだけ最高速度でウェハWを走査することが望ましい。そのため、走査速度Vは通常は最高速度付近に設定されている。また、スリット幅Lは最大幅付近に設定されているとすると、(3)式の右辺はほぼ一定である。従って、ウェハW上のレイヤ等に応じて、フォトレジストの感度Eが異なる場合には、(3)式を満たすために、その感度Eに対応して露光光ILの照度Sを変える必要がある。そのように照度Sを変える際には、例えば光源部16内に露光光の光量を段階的、及び所定範囲内で連続的に可変できる減光機構を設けるか、又は光源部16内の露光光源の駆動電力を制御する可変電源を設け、これらの減光機構、又は可変電源を用いている。このように、露光光ILの照度Sを変化させた場合には、着脱型照度計2の出力に対するインテグレートセンサ18の出力の関係が微妙に変化する恐れがある。

【0062】そこで、走査露光型の投影露光装置では、減光機構、又は可変電源を介して露光光ILの照度Sを変化させながら、インテグレートセンサ18及び着脱型照度計2により露光光ILの照度を計測する。このときインテグレートセンサ18で計測された照度LIを、 $c_i (i=1, 2, 3, \dots, n)$ とする。また、同時に着脱型照度計2で計測された照度LSを a_i とする。

【0063】図7(b)は、着脱型照度計2で計測された照度LSとインテグレートセンサ18で計測された照度LIとの関係を示し、照度LSと照度LIとの線形性が良好であるときには、この図7(b)の実線の直線55で示すように、インテグレートセンサ18における照度LIの実測値 c_1, c_2, \dots, c_n と、着脱型照度計2における照度LSの実測値 a_1, a_2, \dots, a_n との関係はほぼオフセットの無い直線となる。この際には、得られた照度の実測値の比の値 a_i/c_i の平均値を較正パラメータとすることができる。しかしながら、それら2つの照度の間の線形性が悪い場合には、ステッパ型の投影露光装置のように1つの較正パラメータP1を決定し、それに基づいて較正すると照度の測定誤差が大きくなる。

【0064】そこで、走査露光型で2つの照度間の線形性が悪い場合には、着脱型照度計2の照度LSの実測値 a_i に対するインテグレートセンサ18の照度LIの実測値 c_i の比の値 $a_1/c_1, a_2/c_2, a_3/c_3, \dots, a_n/c_n$ を算出し、得られた値 a_i/c_i を曲線近似する。即ち、一例として主制御装置50では、得られた値 a_i/c_i を最小自乗法等によって、インテグレートセンサ18で

計測される照度LIに関するm次（mは2以上の整数）の関数 $f(LI)$ で近似し、この関数 $f(LI)$ の各次数の係数を求めて較正パラメータとして記憶装置13に記憶する。これによって、着脱型照度計2で計測される照度LSは次式で表される。

$$【0065】 LS = f(LI) \cdot LI \quad (4)$$

その後、露光時にインテグレートセンサ18で計測された照度LIに対して、その関数 $f(LI)$ を乗算することで、ウェハステージ1上で着脱型照度計2を用いて計測される照度LSに換算された照度を得られる。なお、そのように曲線近似をする代わりに、得られた照度の比の値 a_i/c_i を照度LIに関するテーブルとして記憶してもよい。この際に、例えばインテグレートセンサ18の照度の実測値 $c_i \sim c_{i+1}$ の間では、比例配分によって比の値 LS/LI を計算し、この値でインテグレートセンサ18の出力を較正するようにしてもよい。

【0066】また、走査露光型の場合も、固定型照度センサ7の較正用のパラメータは、較正後のインテグレートセンサ18を用いて求めることができる。即ち、露光光の照度を変えながら計測されたインテグレートセンサ18の照度LIの実測値 c_i 、及び対応して計測される固定型照度センサ7の照度（これを LS' で表す）の実測値 b_i を用いると、両者の線形性が良好であれば、実測値 c_i 及び b_i の間にも、図7(b)の点線の曲線55Aで示すようなほぼオフセットの無い線形の関係があるため、それらの実測値の比の値 c_i/b_i の平均値を較正パラメータとすることができる。しかしながら、両者の線形性が悪いときには、その値 c_i/b_i を固定型照度センサ7の照度 LS' の高次の関数 $g(LS')$ で近似するか、又はテーブル化すればよい。

【0067】このように較正パラメータを算出することで、走査露光型の場合にも、インテグレートセンサ18及び着脱型照度計2の出力の較正を高精度に行うことができる。また、インテグレートセンサ18及び着脱型照度計2の出力信号は同じタイミングで取り込むことができるため、較正パラメータを正確に求めることができ、インテグレートセンサ18、ひいては固定型照度センサ7の較正を高精度に行うことができる。

【0068】なお、ステッパ型の投影露光装置の場合でも、露光光の照度を変更するときには、インテグレートセンサ18の出力と着脱型照度計2の出力との関係を2次以上の関数で近似して、その関数の各次数の係数を較正パラメータとして記憶してもよい。固定型照度センサ7についても同様である。次に、本発明の第2の実施の形態につき図8及び図9を参照して説明する。本例は、パルス光源を露光光源として使用するステッパ型の投影露光装置に本発明を適用したものであり、図8において図1及び図4に対応する部分には同一符号を付してその詳細説明を省略する。

【0069】図8は、本例の投影露光装置を示す概略構

特開平10-92722

成図であり、この図8の光源部16Aにおいて、パルス発光の露光光源としてArFエキシマレーザ光源、又はKrFエキシマレーザ光源等からなるエキシマレーザ光源40が使用されている。エキシマレーザ光源40の発光動作は、光源制御ユニット15A内のレーザ制御装置41を介して主制御装置50により制御されており、主制御装置50によりエキシマレーザ光源40のパルス発光のタイミング、発振周波数、及び出力の微小制御等が行われている。

【0070】エキシマレーザ光源40から射出されたレーザ光である露光光ILAは、ビームエキスパンダ39、それぞれ種々の透過率のNDフィルタ板を周囲に配列してなる1対の可変NDフィルタ38A、38Bを通過する。駆動部38Cを介して可変NDフィルタ38A、38BのNDフィルタの組み合わせを調整することによって、露光光ILAに対する減光率を多段階に亘って変更できる。駆動部38Cの動作は、主制御装置50が光源制御ユニット15A内の減光部制御系42を介して制御できるように構成されている。可変NDフィルタ38A、38Bを通過した露光光ILAは照明系17Aに入射して、第1のフライアイレンズ37、リレーレンズ36、スペckル除去用の振動ミラー35、及び第2のフライアイレンズ31を経て、ビームスプリッタ33に入射する。

【0071】このビームスプリッタ33で分離された露光光ILAの一部が、集光レンズ43を介してインテグレートセンサ18に入射する。一方、ビームスプリッタ33を透過した露光光ILAは、可変視野絞りやコンデンサレンズ等を含む光学系34を経てレチクルRを照明する。そして、照度の計測時には、レチクルRを透過した露光光ILAが、投影光学系10を介してウエハステージ1上に取り付けられた若脱型照度計2に入射する。若脱型照度計2の出力は、信号ライン4、5、センサ制御装置3、及び不図示のコネクタを介してオンラインで照度制御ユニット12に供給されている。ウエハステージ1上には固定型照度センサ7も固定され、インテグレートセンサ18及び固定型照度センサ7の出力は照度制御ユニット12に供給されている。この他の構成は図1の投影露光装置と同様である。

【0072】この場合、エキシマレーザ光源は1パルス毎の照度（パルスエネルギー）が不安定なので、ウエハ上の各点に対する露光時には、それぞれ例えば数10パルスの露光光が照射されるようにして、平均化効果により照度均一性を維持している。即ち、図8の投影露光装置においては、ウエハ上の各点に対する露光光ILAの最低パルス数が決められている。例えばエキシマレーザ光源40の発振周波数を500Hz、1パルス毎の照度のランダムなばらつきを5%、露光パルス数を50パルスとした場合、50パルス露光後のウエハ上での積算露光量のばらつきは、約0.7%となり、露光時間は0.

1秒となる。

【0073】また、本例では減光部としての可変NDフィルタ38A、38Bの組み合わせによって露光光ILAの照度を段階的に変更でき、且つレーザ制御装置41を介してエキシマレーザ光源40の出力を或る程度連続的に変更できるように構成されている。そこで、本例のようなパルス光源を使用するステッパ型の投影露光装置では、シャッタによる露光量の制御を行わず、エキシマレーザ光源40を所定期間だけパルス発光させると共に、ウエハに対する積算露光量の制御を行うために、露光光ILAの照度を連続的に変化させる方法が考えられる。即ち、ウエハ上のフォトリソの感度をE、ウエハ上における露光光ILAの1パルスのエネルギーをp、露光パルス数をnとすると、次の関係が成立する。

$$【0074】 E = np \quad (5)$$

そこで、フォトリソの感度Eが変わったときには、可変NDフィルタ38A、38Bの透過率の組み合わせにより、段階的に光量を変化させ、レーザ制御装置41によりエキシマレーザ光源40の出力を微調整することで、露光光ILAの1パルスのエネルギーpを連続的に制御する。露光に際しては、この1パルス毎のエネルギーpをインテグレートセンサ18により計測し、それに基づいてエキシマレーザ光源40や可変NDフィルタ38A、38Bを制御する。

【0075】次に、本例において、若脱型照度計2を使用してインテグレートセンサ18の出力を校正する方法について具体的に説明する。まず、若脱型照度計2の受光部をインテグレートセンサ18の受光部の共役像内に移動して、1パルスのエネルギーpを任意に設定し、エキシマレーザ光源40をパルス発光させる。図9(a)は、エキシマレーザ光源40におけるパルス発光のタイミングを示し、横軸は時間t、縦軸はパルス発光時にハイレベル"1"となるフラグFAを示す。この図9

(a)に示すように、先ず時刻tS以降の所定期間TDだけ計測を行うことなくダミーでパルス発光させた後、時刻t1とt2との間の計測期間TM内で計測のためのn回のパルス発光を実施する。

【0076】図9(b)は、インテグレートセンサ18で計測を行う期間だけハイレベル"1"となるフラグFBを示し、図9(c)は若脱型照度計2で計測を行う期間だけハイレベル"1"となるフラグFCを示し、フラグFB及びFCで示すように、インテグレートセンサ18及び若脱型照度計2では時刻t1とt2との間で同時に計測が行われる。この際に、照度制御ユニット12では、各パルス発光毎にインテグレートセンサ18の出力のピークホールド値を取り込み、センサ制御装置3では、各パルス発光毎に若脱型照度計2の出力のピークホールド値をA/D変換して照度制御ユニット12に供給する。このようにして計測される値をも便宜上、各パルス光の照度と呼ぶ。

特開平10-92722

【0077】この場合、インテグレータセンサ18及び若脱型照度計2により計測された1パルス毎の照度をそれぞれ d_i, e_i ($i=1, 2, 3, \dots, n$) とする。照度 d_i と e_i との関係が線形に近い状態であれば、上記

(1) 式のような方法で一定の校正パラメータを求めて記憶する。一方、照度 d_i と e_i との関係が非線形の場合には、照度 d_i と e_i との関係を最小自乗法等の方法により2次以上の関数の形で求め、この関数を校正パラメータとして記憶する。または、照度 d_i と e_i との関係をテーブル化して記憶してもよい。

【0078】次に、校正されたインテグレータセンサ18を基準の照度センサとして固定型照度センサ7の校正パラメータを求める。即ち、インテグレータセンサ18の受光部の共役像内に固定型照度センサ7の受光部を移動し、上述の若脱型照度計2の場合と同様に、エキシマレーザ光源40をパルス発光させながら、インテグレータセンサ18及び固定型照度センサ7により照度を計測する。ここで計測されたインテグレータセンサ18及び固定型照度センサ7のそれぞれの照度を d_i, f_i ($i=1, 2, 3, \dots, n$) とする。照度 d_i と f_i との関係が線形に近い状態であれば上記(2)式のような方法で一定の校正パラメータを求める。照度 d_i と f_i との関係が非線形の場合には、照度 d_i と f_i との関係を関数、又はテーブルの形で求める。実際の露光時にはこのようにして求めた校正パラメータをそれぞれインテグレータセンサ18及び固定型照度センサ7の計測値に乘じることにより、校正された照度が検出される。

【0079】本例でも、若脱型照度計2の出力はオンラインで照度制御ユニット12に供給されているため、光源部16Aからの露光光IL Aの出力が時間的に変動しても、若脱型照度計2に対するインテグレータセンサ18及び固定型照度センサ7の校正を高精度に行うことができる。また、若脱型照度計2、及びインテグレータセンサ18等の計測値が共通に照度制御ユニット12に取り込まれているため、校正パラメータを求めるための演算処理を高速に行うことができる。

【0080】次に、上述の実施の形態で使用されている若脱型照度計2の管理方法の一例につき図10及び図11を参照して説明する。図1の若脱型照度計2は、マッチングを行うべき複数台(例えば10数台)の露光装置に対して基準の照度センサとして使用される。即ち、照度校正が必要な露光装置に若脱型照度計2を取り付け、照度の校正作業が終了した後、その若脱型照度計2をその露光装置から取り外して他の露光装置の校正に使用するという作業が繰り返される。そして、若脱型照度計2により照度が校正された例えば図1の投影露光装置では、その後は、その投影露光装置のインテグレータセンサ18自体が基準の照度計となる。しかしながら、インテグレータセンサ18は露光光に常時照射されるため、その感度特性が経時的に変化していく。例えば感度特性

が3~6カ月程度の間安定してドリフトが生じなければ、その期間内ではそのままインテグレータセンサ18を基準の照度センサとして使用してもよいが、それ以上の期間を経過した場合は、若脱型照度計2のように適切に保管された基準となる照度センサ(基準照度センサ)により、インテグレータセンサ18の校正をやり直すことが望ましい。

【0081】この場合、1台の基準照度センサだけで照度を管理するのはマッチングさせる露光装置の台数が多くなると物理的に困難であり、且つその基準照度センサが故障する恐れもある。そこで、複数の基準照度センサを保有し、例えば1~3台程度の基準照度センサを親機として、その親機によりそれぞれ校正された複数の子機と、それら複数の子機によりそれぞれ校正された複数の孫機とを備えるような階層構造による管理体制が望ましい。

【0082】図10(a)は、基準照度センサの管理体制の一例を示し、この図10(a)において、1台の親機A1に対して3台の子機B1~B3が校正され、それぞれの子機B1~B3に対して複数の孫機C1~Cn, D1~Dj, E1~Emが校正される。親機A1、子機B1~B3、及び孫機C1~Cn等として、図1の若脱型照度計2と同様の基準照度センサが使用される。このような基準照度センサの管理体制を取ることで、多数の露光装置の照度センサの校正を適正に行うことができる。親機A1は、全ての基準照度センサの基準となるため、入射光量に対する感度特性の直線性、及び安定性等に特に優れたものが望ましい。そして、例えば親機A1に対して子機B1~B3の出力の校正を行う際には、例えば実際に露光光の照度を交互に親機A1、及び子機B1~B3で計測するか、又は露光光を2分割して親機A1、及び子機B1~B3で同時に照度を計測し、計測値の比の値が求められる。

【0083】図10(b)は、親機A1の計測値と子機B1~B3の計測値との線形性が良好である場合を示し、この図10(b)の横軸はそれらの基準照度センサに入射する露光光の光量(照度) x 、縦軸は親機A1の計測値に対する子機B1~B3の計測値の比の値(計測比) y である。この場合には、直線56で示すように、光量 x と計測比 y とは、係数 a 及び b を用いて($y = ax + b$)の一次関数で表される。従って、子機B1~B3には、その係数 a 及び b を記憶しておく記憶部を設け、実際の照度の計測時にはこの係数 a 及び b を図1のセンサ制御装置3に供給し、センサ制御装置3で子機B1~B3の計測値を校正してもよい。

【0084】また、親機A1の計測値と子機B1~B3の計測値との関係が非線形である場合には、光量 x に対する計測比 y の関係は、図10(c)の曲線57で示すように、高次の関数($y = f(x)$)で表される。この際には、関数 $f(x)$ の係数を子機B1~B3の記憶部

特開平10-92722

に記憶させておくか、又は光量 x と計測比 y との関係をテーブル化したデータをその記憶部に記憶させておいて、実際の照度の計測時に校正を行えば良い。このように計測比 y を求める際には、図7(b)で説明したような演算を利用してよい。

【0085】次に、例えば図10(a)の子機B1に対して孫機C1～Cnの出力の校正を行う際には、両者の計測比を求め、この計測比を示す係数や関数を孫機C1～Cnの記憶部に記憶させておけばよい。同様に、他の子機B2、B3に対しても、それぞれ対応する下位の孫機の出力の校正が行われる。ここで、これらの基準照度センサ間の校正方法について具体的に説明する。一例として、親機A1に対して図1の着脱型照度計2の出力を校正する場合について説明する。この校正方法として、インテグレータセンサ18の位置で2つの基準照度センサの照度を計測する方法と、ウェハステージ1上で2つの基準照度センサの照度を計測する方法との2通りの方法がある。このため、2つの基準照度センサを収容し、露光光を2つに分割するビームスプリッタを備えた特別の校正用治具が使用される。

【0086】図11(a)は、図4のインテグレータセンサ18の位置で2つの基準照度センサで照度を計測するための校正用治具44の断面図を示し、校正を行う場合には、図4のインテグレータセンサ18及び集光レンズ43を取り外し、その代わりに校正用治具44を配置する。図4の照明系17内のビームスプリッタ33で分離された露光光は、図11(a)の校正用治具44内の集光レンズ43Aを介してビームスプリッタ58に入射し、入射した露光光ILはビームスプリッタ58により2つの光束に分割される。校正用治具44内で、ビームスプリッタ58の2つの射出面に対向するように親機A1及び着脱型照度計2が固定されている。そして、ビームスプリッタ58を透過した光束は親機A1に入射し、ビームスプリッタ58により反射された光束は着脱型照度計2に入射する。親機A1及び着脱型照度計2からの出力信号は信号処理系59に送られ、信号処理系59内で例えば図7(b)に基づいて説明した方法と同様に、親機A1で計測される照度に対する着脱型照度計2で計

測される照度の比の値(校正パラメータ)、又はその比の値を示す関数やテーブルが求められる。そのように求められた校正パラメータ又は関数等はホストコンピュータ60に送られ、そこで記憶されると共に、着脱型照度計2内の記憶部にも記憶される。

【0087】図11(b)は、ウェハステージ1上で親機A1により着脱型照度計2を校正するための校正用治具45の断面図を示し、この図11(b)に示すように校正用治具45をウェハステージ1の上面の外縁部に固定する。校正用治具45内には、投影光学系10からの露光光ILを平行光束にするリレーレンズ61、ビームスプリッタ62、及びビームスプリッタ62からの光束を集光するリレーレンズ63A、63Bが備えられ、リレーレンズ63A、63Bに対向するように親機A1及び着脱型照度計2が固定されている。校正の際はウェハステージ1を駆動して投影光学系10の露光中心にリレーレンズ61、63Aの光軸を一致させる。

【0088】投影光学系10からの露光光ILは、リレーレンズ61を介して平行光束となり、ビームスプリッタ62に入射し、ビームスプリッタ62により2つの光束に分割される。ビームスプリッタ62を透過した光束はリレーレンズ63Aを介して親機A1に入射し、ビームスプリッタ62により反射された光束はリレーレンズ63Bを介して着脱型照度計2に入射する。親機A1及び着脱型照度計2からの出力信号は信号処理系59に送られ、信号処理系59において、図7に基づいて説明した方法と同様に、着脱型照度計2の校正パラメータ又は校正用の関数等が求められる。そのように求められた校正パラメータ又は関数等はホストコンピュータ60で記憶されると共に、着脱型照度計2の記憶部にも記憶される。

【0089】以上のような方法で校正された基準照度センサにより各露光装置間の照度のマッチングが計られるが、マッチング精度として例えば1.4%以下の精度を満たすために、着脱型照度計2及びインテグレータセンサ18の計測特性が以下の許容値を満たすように設定されている。

【0090】

A. 着脱型照度計2

(a) 計測再現性	: ±0.07 [%] (二乗和)
(b) 測定直線性 (ソフト補正後)	: ±0.07 [%] (単純和)
(c) 角度特性機差	: ±0.1 [%] (単純和)
(d) 安定性 (総合照射時間24時間)	: ±0.25 [%] (単純和)

B. インテグレータセンサ18

(a) 計測再現性	: ±0.05 [%] (二乗和)
(b) 測定直線性 (ソフト補正後)	: ±0.05 [%] (単純和)
(c) 角度特性機差	: ±0.1 [%] (単純和)
(d) 安定性 (総合照射時間24時間)	: ±0.25 [%] (単純和)

【0091】以上の項目の内、測定直線性とは入射光量に対する出力の線形性を示し、角度特性機差とは露光光

の開き角(コヒーレンスファクタ)が異なる場合の出力変化のばらつきを示す。なお、各露光装置におけるイン

特開平10-92722

テグレートセンサ18及び固定型照度センサ7に対する校正は、以上のような着脱型照度計2を使用して、露光光源（水銀ランプ等）の交換毎に行われ、計測に要する時間は0.2時間、1台の着脱型照度計2により管理する露光装置の数は20台、着脱型照度計2自体の校正間隔は6ヶ月となっている。

【0092】例えば、本例のインテグレートセンサ18で計測される照度の露光装置間でのマッチング精度MSを計算してみると、基準となる着脱型照度計2が例えば図10(a)の子機B1である場合、親機及び子機の2台分の計測誤差が重なるため、上記計測特性より以下になる。

$$MS = (0.07^2 \times 2 + 0.05^2)^{1/2} + 0.07 \times 2 + 0.05 + 0.1 \times 3 + 0.25 \times 3 \div 1.35 (\%)$$

従って、マッチング精度MSの値は許容範囲の1.4%より小さくなり、高いマッチング精度で照度が計測される。

【0093】なお、以上の各基準照度センサは親機も含めて絶対光量を計測するためのセンサではなく、親機を最上位の基準、即ち親機で計測される照度を一種の絶対光量基準とみなして相対的な光量を計測するセンサである。絶対光量による管理が望ましいが、例えば水銀ランプのi線等を露光光とする場合には、照明輝度が高く平行光線を作り難いため、現状技術では絶対光量管理は難しい。また、上記の計測特性には角度特性機差が記載されているが、小さな角度特性機差を要求する理由は次のC1及びC2の通りである。

【0094】C1. 着脱型照度計2やインテグレートセンサ18のような照度センサの角度特性に基づく誤差には2種類の誤差がある。第1の誤差は、照度センサの受光フィールドより照明フィールドが大きい場合にランバートの法則によって、入射角の余弦(cos)に比例して原理的に発生する誤差である。但し、照度センサの受光面が結像位置にある場合は問題とはならないが、その受光面がデフォーカスしている場合には「けられ」等の誤差となってしまう。この誤差を「受光フィールド特性による誤差」と称する。

【0095】第2の誤差は、照度センサの検出面上のコーティング等で発生する、露光光の入射角に依存した感度変化による誤差である。これを「ディテクタ角度特性による誤差」と称する。このように、照度センサの違いにより角度特性が異なる、即ち角度特性機差があると、変形照明等により露光光の入射角が変化した場合に、相対光量の正確な比較ができない。但し、適正露光量（ドーズ）の設定に際しては、フォトレジストの特性も大きな要因となる上に、通常照明の場合と変形照明の場合とでは別々にドーズの設定が行われるので、インテグレートセンサに関しては、絶対的な角度特性は必要ない。但し、複数の露光装置に対する照度のマッチングを考えた

場合、角度特性機差は大きな測定誤差の要因となる。従って、着脱型照度計2及びインテグレートセンサ18の角度特性機差を小さくする必要がある。以上の点から、上記の角度特性機差の値は、輪帯照明を使用し、且つ照明系の開口絞りとして開口の外径に対して2/3の大きさの遮光部を備えた輪帯を使用するという最も厳しい照明条件を想定して設定されている。

【0096】C2. 固定型照度センサ7の場合は、一例として露光フィールド内の相対的な照度むらを計測するため、像高に依存したσ値（開口数）の差が存在する場合、ディテクタ角度特性による誤差が大きいときには、これらのσ値の差が検出できず、そのために線幅誤差が発生する。一方、ディテクタ角度特性による誤差が小さい場合には、線幅誤差を全てσ値の差として管理することが可能となる。

【0097】なお、上述の実施の形態では、基準照度センサについては、ステッパ型の露光装置と走査露光型の投影露光装置とに関し別々に検討しているが、同じ露光光源を用いている場合は、方式が異なる露光装置間でもマッチングを取る必要がある。そのため、ステッパ型の露光装置及び走査露光型の露光装置に対して共にマッチングが取れるように、着脱型照度計2は図7(a)及び(b)の両方の校正方法に対応できるようになっている。この場合、露光装置により露光フィールドの形状が異なるので、着脱型照度計2の受光部の形状を共通化するか、着脱型照度計2の受光部（プローブ部）のみ取り替え可能に構成することが望ましい。

【0098】上述のように、上述の実施の形態によれば、複数の基準照度センサ（着脱型照度計2）が、親機、子機、及び孫機として階層構造で管理されており、親機を除く基準照度センサは、それぞれ上位の基準照度センサに対する校正パラメータ又は校正関係式を記憶している。従って、下位の基準照度センサはすべて1つの親機を基準として相対照度を計測する結果となり、多数の露光装置を使用する場合でも露光装置間での照度の計測値のマッチング精度が向上する。また、仮に或る基準照度センサが故障しても、他の基準照度センサで代用することができる。

【0099】なお、上述の実施の形態では、着脱型照度計2はオペレータによりウエハステージ1上に着脱されるが、着脱型照度計2を搬送する搬送装置を設置し、ウエハステージ1を待避させて同搬送装置により着脱型照度計2を投影光学系10の露光中心等に移動して照度を計測するようにしてもよい。また、着脱型照度計2をウエハを搬送するためのスライダにより投影光学系10とウエハWとの間に配置するような構成にしてもよい。これらの方法では、オペレータはチャンバー47内に入る必要が無く、照度センサの校正作業をより迅速に行うことができる。

【0100】このように、本発明は上述実施の形態に限

特開平10-92722

定されず、本発明の要旨を逸脱しない範囲で種々の構成を取り得る。

【0101】

【発明の効果】本発明の第1の露光装置によれば、着脱型の照度センサの計測データを取り込むインタフェース装置が設けられ、露光量制御手段で常設の照度センサの出力の着脱型の照度センサの出力に対する関係が求められて記憶される。そのインタフェース装置によって、両照度センサの計測データはほぼ同時に取り込まれるため、露光光源の出力にアーク揺らぎやパルスエネルギーのばらつきによる時間変動があっても、両照度センサの出力の比が正確に求められ、常設の照度センサの較正を高精度に行うことができる利点がある。

【0102】この際に、両照度センサの計測データはその露光量制御手段で共通に処理されているため、計測データの処理を高速に行うことができる。また、オペレータの介入等に起因する入力の違いが発生しない。また、その常設の照度センサが、照明光から分離された光束の照度を検出することによって基板ステージ上での照明光の照度を間接的に計測する間接型の照度センサ（例えばインテグレートセンサ）であり、その露光量制御手段が、そのインタフェース装置を介してその着脱型の照度センサの計測データを取り込むのに同期してその常設の照度センサの計測データを取り込む場合には、2つの照度センサの計測データが同じタイミングで取り込まれるため、露光光源の出力変動がある場合のその常設の照度センサの較正精度を高めることができる。

【0103】また、その露光用の照明光が、パルス発光される照明光であり、その露光量制御手段が、露光用の照明光のパルス発光に同期してそのインタフェース装置を介してその着脱型の照度センサの計測データを取り込む場合には、パルス発光による照明光の照度がオンラインで同期して計測されるため、その着脱型の照度センサ及びその常設の照度センサの計測タイミングがずれることなく照度が正確に計測され、その常設の照度センサの出力の較正を高精度に行うことができる利点がある。

【0104】また、そのインタフェース装置が、コードレス方式でその着脱型の照度センサの計測データをその露光量制御手段に供給する場合には、その着脱型の照度センサをその基板ステージ上に着脱する際の作業が容易になる利点がある。また、本発明の第2の露光装置によれば、多数の露光装置の照度較正を行う場合に、第2の着脱型の照度センサを親機として第1の着脱型の照度センサを子機として、子機の出力の較正を高精度に行うことができる。従って、多数の露光装置間での照度のマッチング精度が向上する利点がある。また、親機に対して複数の子機を設け、更に子機に対してそれぞれ複数の孫機を設けることによって、更に多くの露光装置間の照度のマッチング精度を向上でき、且つ或る着脱型の照度センサが故障した場合等でも、他の着脱型の照度センサで

代用できる。

【0105】また、本発明の第3の露光装置によれば、基板ステージ上において分割光学系により分割された照明光の照度を第1及び第2の着脱型の照度センサにより計測して、その第1の着脱型の照度センサの較正を行うことができるため、照明光の揺らぎや途中の光学系等による影響がなく、その第1の照度センサが高精度に較正される利点がある。従って、露光装置間のマッチング精度が向上する。

【図面の簡単な説明】

【図1】本発明による露光装置の第1の実施の形態を示す概略構成図である。

【図2】(a)は図1の着脱型照度計2をウエハステージ1上に取り付けた状態を示す拡大図、(b)は図2(a)の平面図、(c)はコードレス方式の着脱型照度計2Aを示す拡大図である。

【図3】図1の着脱型照度計2の位置を求める方法を説明するための図である。

【図4】図1の照明系17の詳細を示す構成図である。

【図5】(a)は図1の着脱型照度計2により露光フィールド内の照度を計測する方法を示す平面図、(b)は図1の固定型照度センサ7により露光フィールド内の照度を計測する方法を示す平面図である。

【図6】(a)は図4の投影露光装置の照明系17内のフライアイレンズの射出面に設けられる開口絞りの例を示す平面図、(b)はそれぞれ小さい開口角の露光光がレチクルRに入射する状態を示す図、(c)は大きい開口角の露光光がレチクルRに入射する状態を示す図である。

【図7】(a)はステッパ型の投影露光装置における較正パラメータの算出方法の説明図、(b)は走査露光型の投影露光装置における較正パラメータの算出方法の説明図である。

【図8】本発明の第2の実施の形態の投影露光装置を示す概略構成図である。

【図9】図8のエキシマレーザ光源を使用した場合のパルス発光のタイミング、及びその際のインテグレートセンサ等の計測のタイミングを示す図である。

【図10】(a)は本発明の実施の形態において基準照度センサの管理のための階層構造を示す図、(b)は図10(a)の基準照度センサ間における較正のための線形関数を示す図、(c)は図10(a)の基準照度センサ間における較正のための非線形関数を示す図である。

【図11】(a)は本発明の実施の形態において基準照度センサを較正するための較正用治具の一例を示す図、(b)はその較正用治具の別の例を示す図である。

【図12】従来の照度センサを備えた投影露光装置を示す概略構成図である。

【符号の説明】

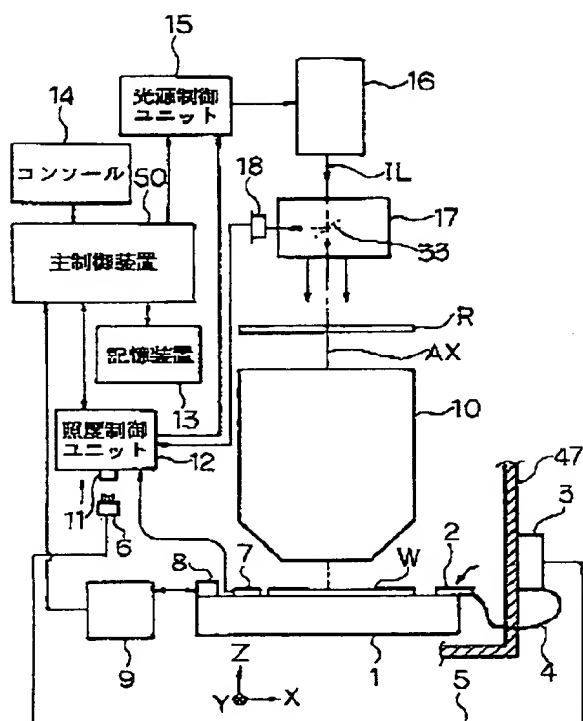
R レチクル

特開平10-92722

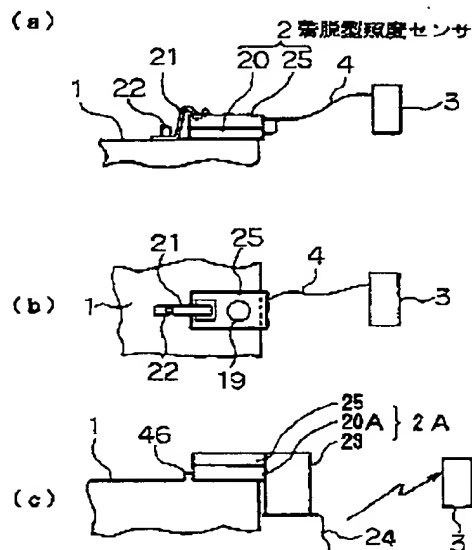
- W ウエハ
 1 ウエハステージ
 2 着脱型照度計
 3 センサ制御装置
 4, 5 信号ケーブル
 6 コネクタ
 7 固定型照度センサ
 10 投影光学系
 11 コネクタ
 12 照度制御ユニット
 13 記憶装置
 14 コンソール
 15 光源制御ユニット
 16 光源部

- 17 照明系
 18 インテグレータセンサ
 20 温調素子
 23 電源部
 25 光電変換部
 40 エキシマレーザ光源
 41 レーザ制御装置
 42 減光部制御系
 44, 45 較正用治具
 50 主制御装置
 52A~52D 開口絞り
 58, 62 ビームスプリッタ
 59 信号処理系
 60 ホストコンピュータ

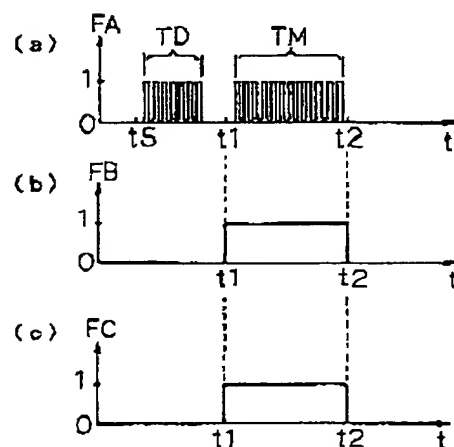
【図1】



【図2】

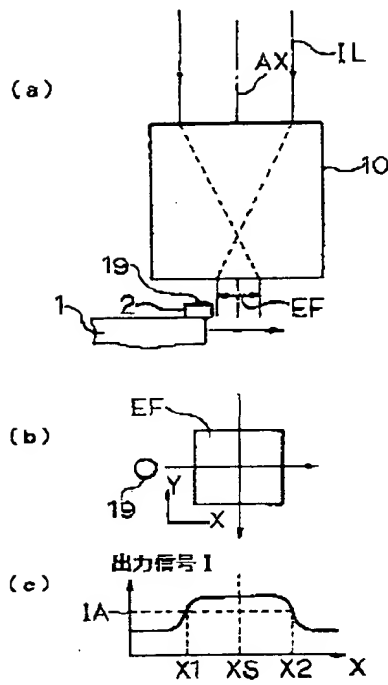


【図9】

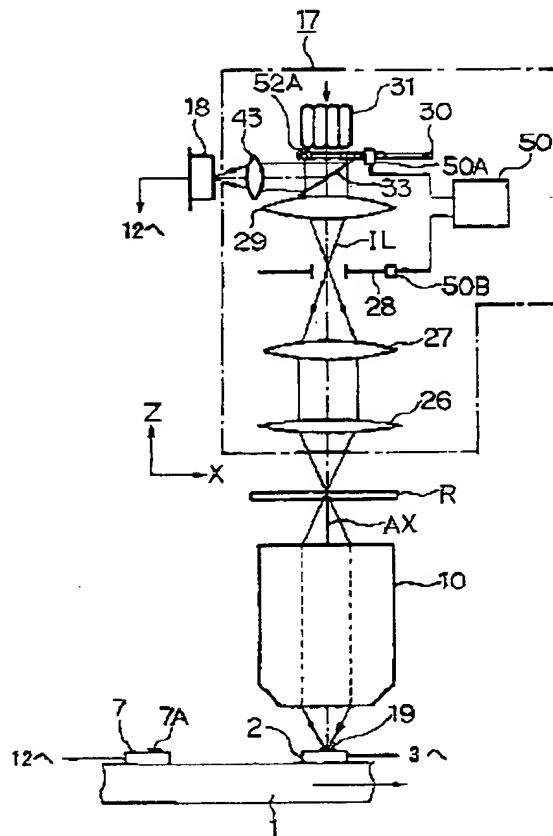


特開平10-92722

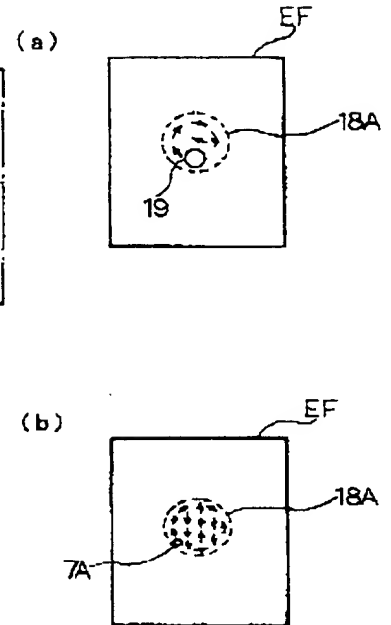
【図3】



【図4】

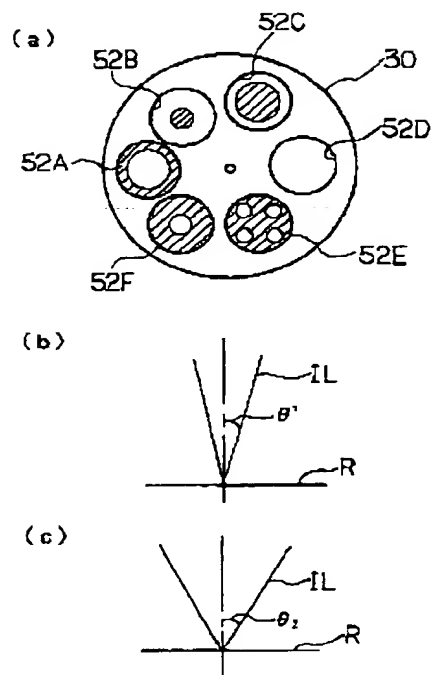


【図5】

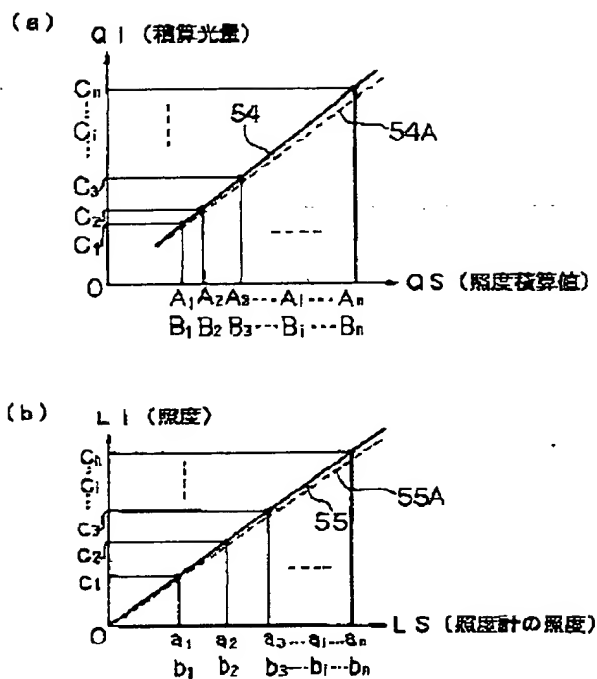


特開平10-92722

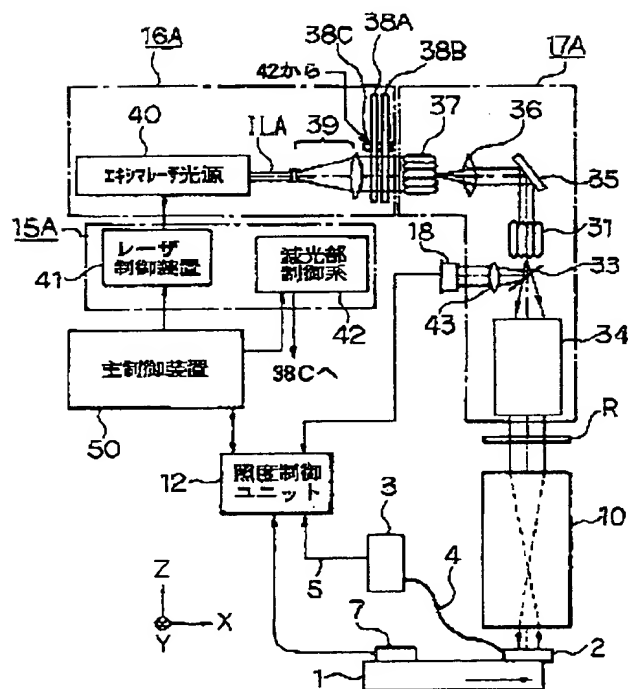
【図6】



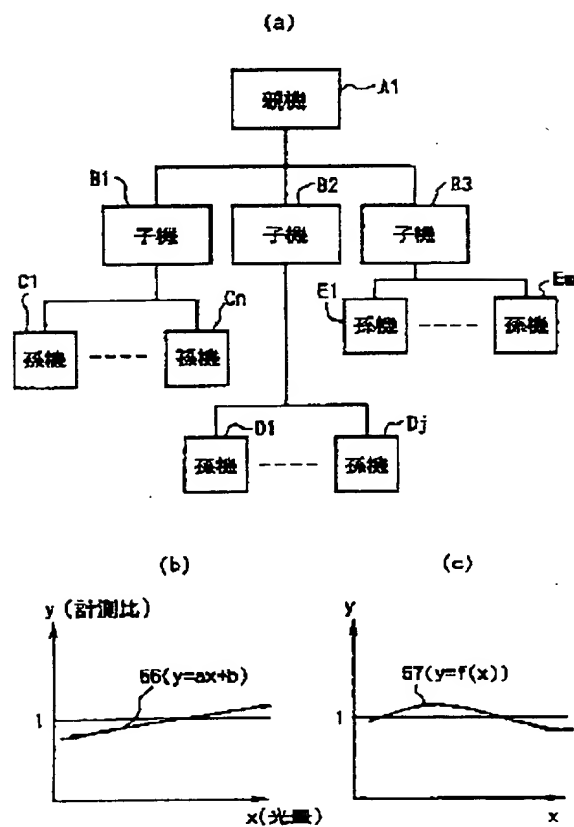
【図7】



【図8】

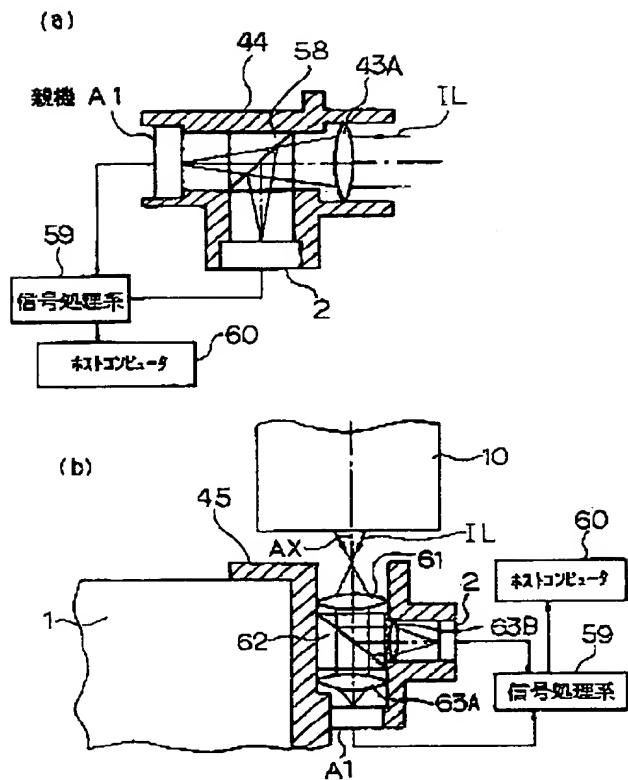


【図10】



特開平 10-92722

【図 11】



【図 12】

